

Представьте себе вакуумную установку, позволяющую распылять до 6-ти различных материалов в одном цикле.

Представьте, что Вы можете проводить полноценные исследования материалов, получаемых методом ионно-лучевого или магнетронного распыления, без затрат времени на переналадку и откачку .

Представьте, что Вам необходимо только заложить программу напыления сложного покрытия, а установка сама напылит требуемое количество слоев, измерит их оптические характеристики и остановит процесс по его завершении.

Представьте, что теперь Ваши знания найдут настоящее применение. Вы не только знаете, какое покрытие необходимо получить, но можете сделать это.

Представьте, что у вакуумной установки есть характер. Характер настоящего профессионала и специалиста. **Ваш характер.**

Новейшее поколение вакуумных напылительных установок

ASPIRA 150



Компания Изовак представляет принципиально новую по конструкции, характеристикам и возможностям вакуумную напылительную установку Aspira 150 для получения высокостабильных приципзионных оптических покрытий. Вакуумная установка Aspira 150 оснащена технологиями ионно-лучевого и магнетронного распыления, комбинация которых позволяет решать оптические задачи, предъявляющие повышенные требования к точности напыления, дефектности, повторяемости и долговременной стабильности покрытий.

Типы покрытий:

- лазерные покрытия
- высокоотражающие зеркала
- многоволновые спектроделители
- токопроводящие покрытия

Области применения покрытий:

- специальная техника
- лазерная оптика
- научные приборы
- приборы медицинского назначения
- приборы космического применения

Особенности конструкции:

- до 6-ти различных материалов мишеней
- комбинирование ионно-лучевого и магнетронного распыления
- ионно-лучевая очистка
- шлюзовая система
- встроенный оптический контроль по детали

Основные характеристики вакуумной установки Aspira 150:

Максимальная зона напыления	Диаметр 150 мм
Тип подложки	Кварц, стекло, сапфир, кремний, германий
Достижимая равномерность покрытий	+/- 0,4 %
Система распыления	Ионно-лучевой источник с компенсатором ионного заряда; Кольцевой магнетрон на постоянном токе; 6-ти позиционный узел смены мишеней
Система очистки подложек и ассистирования	Ионный источник очистки с компенсатором ионного заряда
Блоки питания	Соответствуют требованиям СЕ, имеют встроенные высокоэффективные системы дугогашения, защиты от короткого замыкания, регулировки по току, напряжению и мощности
Напыляемые покрытия	УФ, видимый и ИК - диапазоны
Встроенный оптический контроль	- спектральный с поддиапазонами 200-380, 380-720, 720-1100, 1100-1700 нм; - одноволновой с диапазоном 1,0-5,0 мкм
Рабочие газы	Аргон, Кислород, Гелий, Азот
Система охлаждения	Изолированная от системы водоснабжения предприятия, замкнутая, точность установки и поддержания температуры +/- 1,0 С0
Высоковакуумная откачка	Турбомолекулярный или криогенный насос
Форвакуумная откачка	Сухой безмасляный насос
Расчетное энергопотребление	20 кВт
Габаритные размеры	2000 x 2000 x 1600 мм
Расчетная площадь, требуемая для оборудования	3000 x 3000 мм
Гарантия	2 года с момента сдачи в эксплуатацию
Срок поставки	До 150 дней

Почему Изовак?

- более 20 лет разработок ионно-лучевых технологий
- более 15 лет разработок специализированных вакуумных установок
- более 130 вакуумных установок, запущенных в эксплуатацию в России, Японии, Тайване, Малайзии, Южной Корее, Франции и Германии.